*μ-e*転換過程探索実験 DeeMe のための 磁気スペクトロメータの運動量校正

Momentum calibration for the DeeMe experiment searching for muon-electron conversions

理学研究科

数物系専攻

田川 椋平

ミューオン・電子転換過程 ($\mu^- + (A, Z) \rightarrow e^- + (A, Z)$) は荷電レプトン・フレー バーを保存しない過程で (charged Lepton Flavor Violation, cLFV),素粒子の標準模型 では禁止されている. しかしながら,標準模型を超えた多くの物理モデルでは現在の実 験による分岐比の上限値 10⁻¹² の数桁下に cLFV が存在すると予言されている. ミュー オン・電子転換過程探索実験 DeeMe (Direct emission of electron by Muon-electron conversion) は茨城県東海村の大強度陽子加速器施設 (J-PARC) の物質・生命科学実験 施設 (Material and Life Science Experimental Facility, MLF) で計画されている実験 で,3 GeV 陽子シンクロトロン (RapidCycling Synchrotron, RCS) からの大強度高純 度パルス陽子ビームを活用することによって単一事象感度 10⁻¹³ の実験を実現しようと している.

探索する粒子は 105 MeV/cの運動量を持った遅延電子であるため, DeeMe では運動 量を測定するための飛跡検出器を用いて遅延電子を観測する. DeeMe は MLF の Highmomentum muon beamline (H-Line) と呼ばれるビームラインを用いて実験を行なう. H-Line は 2022 年 1 月 15 日に初めてビームが開通した,新しいビームラインである. ソレノイドや双極磁石,四重極磁石で構成されており,これらを利用して特定の運動量 を持った荷電粒子を標的から選び出して輸送することができる. H-Line が荷電粒子を輸 送したその先に H1 と呼ばれる実験エリアがあり, DeeMe はここに磁気スペクトロメー タを設置して実験を行なう. H1 エリアに搬入する実験装置は PACMAN と呼ばれる大 きな双極電磁石と,飛跡検出器の役割を担う 4 つの Multi Wire Proportional Chamber である.

DeeMe では磁気スペクトロメータの運動量校正を行なう.運動量校正に利用する運動 量がよく知られている粒子の候補として Michel 崩壊陽電子の最大運動量(52.8 MeV/c) を利用する.本研究ではグラファイト標的や校正標的で静止した正ミューオンが崩壊し て放出する Michel 崩壊陽電子を用いて電子スペクトロメータの運動量校正を行うため に, H-Line を G4-beamline に再現してシミュレーションを行なう.

グラファイト標的では陽子の入射時,大量のパイ中間子と電子,陽電子などの荷電粒 子が発生する.この大量の荷電粒子を即発粒子と呼び,ほとんどが陽子入射から 200 ns 以内に発生する.このうち正パイ中間子が崩壊して生まれた低運動量の正ミューオンが 標的表面や内部で Michel 崩壊を起こし,陽電子を生み出す.この Michel 崩壊陽電子は ミューオンの崩壊寿命で生成されるため,即発粒子を避けた遅延タイミング(1 µs~) で測定する.正ミューオンが生成する Michel 崩壊陽電子を輸送するシミュレーション を行った結果,最大運動量の付近の運動量分布を確認することができた.遅延タイミン グのバックグラウンドは 0.06% 程度であり十分に低いことが分かった.今後は実デー タとの比較を行なう必要がある.

校正標的を用いる方法としてビームライン途中にアルミニウム板(厚み 1 mm, 縦横 300 × 300 mm)やカプトンストリップ(厚み 2 µm, 縦 300 mm, 横 2 mm)を置き, 静止標的として利用する. グラファイト標的から 40 MeV/c の低運動量の正パイ中間子 をアルミニウム板まで輸送し,静止,崩壊させる. その後,下流部で 69.8 MeV/c の輸送設定で輸送するシミュレーションを行なった. その結果, H-Line 出口での陽子バル スビーム 1 回あたりの π_{e2} 崩壊陽電子数は 8.1 × 10⁻⁵ event であった. バックグラウン ドの陽電子数は 3.0 × 10⁻² event と分かった.

グラファイト標的から 10 MeV/c の低運動量の正ミューオンをカプトンストリップまで 輸送し,静止,崩壊させる. その後,下流部で 52.8 MeV/c の輸送設定で輸送するシミュ レーションを行なった. その結果, H-Line 出口での陽子バルスビーム1回あたりの信号 数は 4.1 × 10⁻⁴ event であった. 校正標的を用いる際のバックグラウンドとして標的由 来の正パイ中間子と正ミューオンがビームライン中で遅延陽電子を生む可能性がある. バックグラウンドの陽電子は陽子パルスビーム 1 回あたり 3.3 event であった. 今後は, ビームラインに設置された粒子弁別装置を用いたバックグラウンドの低減を検討する必 要がある.

目 次

| 1 | 序章 | E <u>a</u> | 8 |
|----------|-----|---|----|
| | 1.1 | 標準模型 | 8 |
| | 1.2 | 荷電レプトン・フレーバー非保存過程 | Ģ |
| | 1.3 | ミューオン・電子転換過程.............................. | 11 |
| | 1.4 | ミューオン・電子転換仮定のシグナルとバックグラウンド | 13 |
| 2 | 実駒 | 計画 | 15 |
| | 2.1 | J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) | 15 |
| | | 2.1.1 Linac | 15 |
| | | 2.1.2 RCS (Rapid Cycle Synchrotron) | 16 |
| | | 2.1.3 MR(Main Ring) \ldots | 16 |
| | | 2.1.4 MLF (Material and Life Science Experimental Facility) | 16 |
| | 2.2 | DeeMe 実験 | 16 |
| | | 2.2.1 H-line (High-momentum muon beamline) | 18 |
| | | 2.2.2 H-line ビーム出口詳細 | 22 |
| | | 2.2.3 DeeMe 実験における物理解析とバックグラウンド | 22 |
| | 2.3 | 陽子標的兼ミューオン静止標的 | 23 |
| | 2.4 | H1 エリア | 23 |
| | | 2.4.1 磁気スペクトロメータ | 23 |
| | | 2.4.2 双極電磁石 (PACMAN) | 26 |
| | | 2.4.3 飛跡検出器 (Multi Wire Proportional Chamber) | 27 |
| 3 | 運動 | b量校正粒子 | 28 |
| | 3.1 | 1 次粒子の利用 | 28 |
| | | 3.1.1 Michel 崩壞 | 28 |
| | 3.2 | 2 次粒子の利用 | 28 |
| | | $3.2.1$ π_{e2} 崩壊による陽電子 | 29 |
| | | 3.2.2 Michel 崩壊による陽電子 | 29 |
| 4 | モン | ・ テカルロシミュレーション | 32 |
| | 4.1 | グラファイト標的で生成される粒子 | 32 |
| | 4.2 | 輸送粒子の水増し................................ | 35 |
| | | 4.2.1 target 水増し | 36 |
| | | 4.2.2 MSR 水増し | 36 |
| | 4.3 | 水増しの妥当性評価 | 36 |
| 5 | グラ | ラファイト標的由来の Michel 陽電子 | 40 |
| | 5.1 | グラファイト標的由来 Michel 陽電子の輸送シミュレーション | 40 |
| | 5.2 | H-line 輸送 | 4(|
| | 5.3 | H-line 輸送運動量アクセプタンス評価 | 42 |
| | 5.4 | H-line 輸送運動量アクセプタンス補正と実データ比較......... | 44 |

| | | 5.4.1 | 各 WC のヒット数の比較 | 44 |
|---|-----|---------------|---|-----------|
| | | 5.4.2 | 運動量構成数比較 | 46 |
| | | 5.4.3 | PACMAN Scan 結果比較 | 46 |
| | 5.5 | バック | グラウンドについて | 47 |
| 6 | 校正 | E用試料 | の利用について | 50 |
| | 6.1 | π_{e2} 崩場 | 裏陽電子のシミュレーション | 51 |
| | | 6.1.1 | π_{e2} 崩壊陽電子のシグナル | 51 |
| | | 6.1.2 | <i>π</i> _{e2} 崩壊陽電子の測定でのバックグラウンド | 53 |
| | 6.2 | Michel | 崩壊陽電子のシミュレーション | 53 |
| | | 6.2.1 | Michel 崩壊陽電子のシグナル | 53 |
| | | 6.2.2 | Michel 崩壊陽電子のバックグラウンド | 55 |
| 7 | 結論 | Đ | | 58 |
| 謝 | 辞 | | | 59 |

図目次

| 1.1 | ニュートリノ振動を考慮したミューオン・電子転換過程のダイアグラム... | 10 | | | | |
|------|---|----|--|--|--|--|
| 1.2 | 光子を伴うミューオン・電子転換過程のファインマンダイアグラム 12 | | | | | |
| 1.3 | 光子を伴わないミューオン・電子転換過程のファインマンダイアグラム | 12 | | | | |
| 1.4 | Czarnecki らによる DIO 電子のエネルギースペクトル.Si (青),C (赤).赤 | | | | | |
| | 線を見ると μ-e 転換電子の運動量である 105 MeV/c 付近まで分布しているこ | | | | | |
| | とが分かる | 14 | | | | |
| 2.1 | J-PARC 鳥瞰図 | 15 | | | | |
| 2.2 | RCS からくる陽子ビーム構造 | 17 | | | | |
| 2.3 | DeeMe 実験の全体図 [1] | 17 | | | | |
| 2.4 | パルス陽子ビームの時間構造と DeeMe 実験における信号探索時間 | 18 | | | | |
| 2.5 | MLF H1 エリア | 19 | | | | |
| 2.6 | G4beamline で描かれた H-line | 19 | | | | |
| 2.7 | H-line を上から見た様子.上部が下流側 | 20 | | | | |
| 2.8 | g-2/EDM 実験の概要 | 21 | | | | |
| 2.9 | MuSEUM 実験の概要 | 21 | | | | |
| 2.10 | H-line を実験室から見た様子 | 22 | | | | |
| 2.11 | グラファイト製回転標的 | 24 | | | | |
| 2.12 | H1, H2の俯瞰 | 24 | | | | |
| 2.13 | 磁気スペクトロメータ.右側がビーム上流,左側がビーム下流である.... | 25 | | | | |
| 2.14 | DeeMe 実験に用いられる飛跡検出器 MWPC | 25 | | | | |
| 2.15 | DeeMe 実験に用いられる双極電磁石 PACMAN | 26 | | | | |
| 2.16 | DeeMe の MWPC の断面図 | 27 | | | | |
| 3.1 | Michel 崩壊陽電子の運動量分布(崩壊時) | 29 | | | | |
| 3.2 | 校正用試料の配置場所について............................ | 30 | | | | |
| 4.1 | 標的の外に出てきた π ⁻ の運動量分布, <200 ns | 33 | | | | |
| 4.2 | 標的の外に出てきた π ⁺ の運動量分布, <200 ns | 33 | | | | |
| 4.3 | 標的の外に出てきた μ ⁻ の運動量分布, <200 ns | 33 | | | | |
| 4.4 | 標的の外に出てきた μ ⁺ の運動量分布, <200 ns | 34 | | | | |
| 4.5 | 標的の外に出てきた電子の運動量分布, <200 ns | 34 | | | | |
| 4.6 | 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布, <200 ns | 34 | | | | |
| 4.7 | 標的の外に出てきた電子の運動量分布, >200 ns | 35 | | | | |
| 4.8 | 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布, >200 ns | 36 | | | | |
| 4.9 | [MSR 水増し前] 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布,時間分布,位置分 | | | | | |
| | 布,運動方向 >200 ns | 37 | | | | |
| 4.10 | [MSR 水増し後] 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布,時間分布,位置分 | | | | | |
| | 布,運動方向 >200 ns | 37 | | | | |
| 4.11 | Michel 崩壊陽電子の H-Line 輸送シミュレーション | 38 | | | | |
| 4.12 | [MSR 水増し前]H-line 出口まで輸送された Michel 陽電子の運動量分布,時間 | | | | | |
| | 分布,位置分布と運動方向 >200 ns | 39 | | | | |

| 4.13 | [MSR 水増し後]H-line 出口まで輸送された Michel 陽電子の運動量分布,時間 | |
|------|---|----|
| | 分布,位置分布と運動方向 >200 ns | 39 |
| 5.1 | 水増し生成したグラファイト標的由来の Michel positron と間接的に発生し | |
| | た陽電子の運動量分布 | 40 |
| 5.2 | 磁場 ID2 で再構成された運動量の分布(Prompt timing から 200 sec 以降の | |
| | もの) | 41 |
| 5.3 | 各輸送設定で再構成された運動量の分布(Prompt timing から 200 nsec 以降 | |
| | のもの) | 42 |
| 5.4 | 45-60 MeV で運動量フラットに生成した陽電子 | 43 |
| 5.5 | 各輸送設定での運動量アクセプタンス | 43 |
| 5.6 | 各輸送設定での運動量分布 [アクセプタンス補正分布](Prompt timing から | |
| | 200 nsec 以降のもの) | 44 |
| 5.7 | アクセプタンス補正分布と輸送前分布の比較............... | 45 |
| 5.8 | 各 WC の検出総数(simulation)2nd prompt timing から 20.5 µs 後 | 45 |
| 5.9 | 各 WC の検出総数(実データ)2nd prompt timing から 20.5 µs 後 | 46 |
| 5.10 | 運動量再構成数の比較 (simulation vs real data). ID30の 57MeV スケール | |
| | での値を1として規格化 | 47 |
| 5.11 | H-Line の輸送設定 52MeV/cのPACMAN scan での再構成数(simulation vs | |
| | real data). Pacman momentum 52 MeV/c の値を1として規格化 | 48 |
| 5.12 | H-Line の輸送設定 55MeV/cのPACMAN scan での再構成数(simulation vs | |
| | real data). Pacman momentum 52 MeV/c の値を1として規格化 | 48 |
| 5.13 | 標的由来の Michel positron とビームライン中で発生した崩壊陽電子の運動量 | |
| | 分布比較 [H-Line 出口地点での分布 / trigger] | 49 |
| 6.1 | 校正標的を用いたスペクトロメータ校正の概念図.(1)HS1–HS3の輸送運動量 | |
| | 設定は (2)の校正用試料位置以降の (3)HB2-spectrometer の中心運動量より | |
| | も小さく設定する | 50 |
| 6.2 | 陽子パルスビーム1回あたりに校正標的に到達する π ⁺ の運動量分布と粒子数 | 51 |
| 6.3 | 校正標的から下流側に出てくる π _{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c) と Michel 崩壊 | |
| | 陽電子 (52.8MeV/c以下)の運動量分布(校正標的に当てる π ⁺ 数を 1e8 event | |
| | に水増し) | 52 |
| 6.4 | 陽子パルスビーム 1 回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する π _{e2} 崩壊 | |
| | 陽電子 (69.8 MeV/c) の運動量分布と粒子数 | 52 |
| 6.5 | 陽子パルスビーム 1 回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する π _{e2} 崩壊 | |
| | 陽電子 (69.8 MeV/c, 赤) とバックグラウンド陽電子(主に Michel 崩壊陽電 | |
| | 子 (52.8 MeV/c 以下), 黒)の運動量分布と粒子数 | 53 |
| 6.6 | 陽子パルスビーム 1 回あたり,入射から 250 ns 後の H-line 出口 (H1 エリア) | |
| | に到達する π _{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c, 赤) とバックグラウンド陽電子(主 | |
| | に Michel 崩壊陽電子 (52.8 MeV/c 以下), 黒)の運動量分布. 陽子パルスビー | |
| | ムの入射からおよそ 200 ns 後に校正標的に π ⁺ が入射されるため,さらに遅 | |
| | いタイミングを見れば π+ が物質からはじき出す陽電子は減少する. | 54 |
| | | |

6.7 陽子パルスビーム1回あたりに校正標的に到達する μ^+ の運動量分布と粒子数 55

| 6.8 | 校正標的から下流側に出てくる Michel 崩壊陽電子の運動量分布(校正標的に | |
|------|--|----|
| | 当てる µ ⁺ 数を 1e8 event に水増し) | 56 |
| 6.9 | 陽子パルスビーム1回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する Michel 崩 | |
| | 壊陽電子と粒子数 | 56 |
| 6.10 | H-line 出口 (H1 エリア) に到達する Michel 崩壊陽電子(赤)とビームライ | |
| | ン中で発生した陽電子(BG,黒)の運動量分布(陽子パルスビーム1回あた | |
| | り,入射から 600 ns 後) | 57 |
| | | |

表目次

| 1.1 | クォークとレプトン(フェルミオン) | 8 |
|-----|--|----|
| 1.2 | ゲージボソン | 8 |
| 1.3 | 代表的な cLFV 過程探索実験における分岐比の上限値 | 10 |
| 2.1 | RCS パラメータ一覧 | 16 |
| 2.2 | PACMAN 電磁石の仕様 | 27 |
| 4.1 | 炭素標的から出てくる粒子の種類と数(POT 10 ¹⁰ 入射から 200 nsec 以内) | 32 |
| 4.2 | 炭素標的から出てくる粒子の種類と数(入射陽子1つあたり, 入射から 200 | |
| | nsec 以降) | 35 |
| 4.3 | ID30 の各マグネットの電流値 | 38 |
| 5.1 | ID2 の各マグネットの電流値 | 41 |

1 序章

1.1 標準模型

素粒子物理学は,物質の最も基本的な構成要素である素粒子やその相互作用を研究し,自 然法則を明らかにすることを試みる学問である.素粒子の振る舞いを良く記述する理論と して標準模型が確立されてきた.標準模型(Standard Model)は,素粒子物理学における 基本的な理論的枠組みであり,物質の最も基本的な構成要素とその相互作用についての理論 である.標準模型では,物質を構成するクォークとレプトン(表 1.1),さらに力を媒介する ゲージボソン(表 1.2)が素粒子とされる.

表 1.1: クォークとレプトン(フェルミオン)

| 世代 | 第1世代 | 第 2 世代 | 第3世代 | 電荷 $Q/ e $ | スピン |
|------|--------|------------|------------|------------|-----|
| クォーク | u | с | t | +2/3 | 1/2 |
| | d | S | b | -1/3 | 1/2 |
| レプトン | $ u_e$ | $ u_{\mu}$ | $ u_{	au}$ | 0 | 1/2 |
| | е | μ | au | -1 | 1/2 |

表 1.2: ゲージボソン

| ボソン | 媒介する力 | 電荷 $Q/ e $ | スピン |
|------------------------|--------|------------|-----|
| γ (フォトン) | 電磁相互作用 | 0 | 1 |
| g(グルーオン) | 強い相互作用 | 0 | 1 |
| W±(W ボソン) | 弱い相互作用 | ± 1 | 1 |
| Z ⁰ (Z ボソン) | 弱い相互作用 | 0 | 1 |

2012 年 7 月,スイスにある欧州合同原子核研究機構(CERN)の陽子-陽子衝突加速器 LHC で実験している ATLAS と CMS のグループによって,標準模型で予測されながらも 唯一発見されていなかったヒッグス粒子が発見された.この発見により,標準模型を構成す る素粒子は揃ったものの,標準模型では説明できない現象がいくつか見つかっている.例え ば,ニュートリノの質量が 0 では無いことが挙げられる.中性レプトンであるニュートリ ノが他の世代のニュートリノへ遷移するニュートリノ振動が 1998 年,神岡鉱山に設置され たスーパーカミオカンデにより発見されたことでニュートリノが質量をもつということが明 らかとなった.標準模型においてニュートリノの質量は厳密に 0 であるため,ニュートリ ノ振動の発見は標準模型が不完全な理論であることを示す証拠の一つとなっている.

このように,標準模型は完全では無いため,標準模型を越える新しい理論が模索されている.同時に,新しい理論につながる現象の探索が世界中の研究者によって行なわれている. その一つが荷電レプトンフレーバー非保存過程である.本章では,レプトンフレーバー保存 を破る過程とミューオン・電子転換過程探索実験 DeeMe [1] について述べていく.

1.2 荷電レプトン・フレーバー非保存過程

標準模型では物質を構成する基本的な要素としてクォークとレプトンが存在し、レプトン にはそれぞれの世代で固有の量子数が定義されている.第一世代 (e, ν_e) は電子レプトン数 L_e ,第二世代 (μ , ν_{μ}) はミューオンレプトン数 L_{μ} ,第三世代 (τ , ν_{τ}) はタウレプトン数 L_{τ} と定められており、これらの量子数はレプトンフレーバーとして知られている. それぞれに 対して、粒子には +1 の量子数を、反粒子には -1 の量子数を、他の粒子には 0 の量子数 を課す.素粒子の相互作用において反応の前後でレプトンフレーバー量子数の総和は保存す る. これをレプトンフレーバー数保存と呼ぶ.例として式 (1.1) について考える. レプトン 数を見ると、左辺は L_e が 0、 L_{μ} が +1、右辺は L_e が +1 + (-1) = 0、 L_{μ} が +1 となるた め、レプトンフレーバー量子数は保存している.

$$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \tag{1.1}$$

一方で、クォークのフレーバーは保存されない.標準模型では素粒子はヒッグス粒子と 湯川相互作用をすることで質量を得る.クォークの質量固有状態は左巻きの u クォークと d クォークについて質量行列を独立に対角化することで得られるが、この状態は弱い相互作 用を記述する SU(2) ゲージ群の二重項に統合されなければならない.このとき 2 つの状態 の間をつなぐ相対的な回転自由度から、フレーバーの混合が生じる.レプトンについては ニュートリノの質量が 0 であるため、質量固有状態は SU(2) の二重項全体の回転で得られ る.よって荷電レプトンではフレーバーの混合が生じず、レプトンフレーバー数が保存され る.しかしニュートリノ振動現象の観測により、標準模型の仮定であるニュートリノの質量 は 0 は不適であると判明し、弱い相互作用においてレプトンフレーバー数保存は成立しな いことが確認された.

しかしながら荷電レプトンにおいてレプトン・フレーバー非保存過程 (charged Lepton Flavor Violation,cLFV) は未だ観測されていない.標準模型の枠組みでニュートリノ混合を考慮し て cLFV 過程を考えると、ミューオンが仮想的に W ボソンを放出し ν_{μ} となる.ニュート リノ混合により ν_{μ} が ν_{e} になり、W ボソンを吸収すると μ^{-} の稀崩壊 $\mu^{-} \rightarrow e^{-} + \gamma$ にな る.しかし、この過程 (図 1.1) の分岐比は、Maki-Nakagawa-Sakata (MNS) ニュートリノ 混合行列成分 $U_{\mu i}, U_{e i}$ とニュートリノの質量 2 乗差 $\Delta m_{i j}^{2}$, W ボソンの質量 M_{W} を用いて 式 (1.2) であらわされ、ニュートリノの質量差が W ボソンの質量に比べ非常に小さいため、 10⁻⁵⁴ 以下と非常に小さくなる.現在の技術では 10⁻⁵⁴ の分岐比の過程を観測することは困 難である.

$$Br(\mu \to e\gamma) = \frac{3\alpha}{32\pi} \left| \sum_{i=2,3} U^*_{\mu i} U_{ei} \frac{\Delta m^2_{ij}}{M^2_W} \right|^2 < 10^{-54}$$
(1.2)

標準模型の枠組みでニュートリノ混合を考慮した cLFV 過程の観測は困難であるものの, cLFV 過程の観測は新しい物理の証拠になる.既に標準模型を越える多くの新しい理論モデ ルでは cLFV 過程の分岐比は現在の上限値の数桁下であると予想している. cLFV 過程の 分岐比と現在の実験上限値をまとめたものが表 1.3 である. これらが示す上限値は現在の実 験技術で観測できる程度の分岐比である.



図 1.1: ニュートリノ振動を考慮したミューオン・電子転換過程のダイアグラム

表 1.3: 代表的な cLFV 過程探索実験における分岐比の上限値

| 分岐比の上限値 | 実験 |
|------------------------|--|
| $<5.7\times10^{-13}$ | MEG [2] |
| $<1.0\times10^{-12}$ | SINDRUM [3] |
| $<7\times10^{-13}$ | SINDRUMII [4] |
| $<4.3\times10^{-12}$ | SINDRUMIII [5] |
| $<4.4\times10^{-8}$ | Belle $[6]$ |
| $< 1.2 \times 10^{-5}$ | DELPHI $[7]$ |
| $<4.7\times10^{-12}$ | BNL E871 [8] |
| $<2.0\times10^{-7}$ | CDF [9] |
| $< 6.4 \times 10^{-8}$ | CDF [10] |
| | 分岐比の上限値 < 5.7×10^{-13} < 1.0×10^{-12} < 7×10^{-13} < 4.3×10^{-12} < 4.4×10^{-8} < 1.2×10^{-5} < 4.7×10^{-12} < 2.0×10^{-7} < 6.4×10^{-8} |

ミューオン・電子転換過程には光子を伴う過程 ($\mu \rightarrow e\gamma$) と伴わない過程 ($\mu N \rightarrow eN$) がある. その有効ラグランジアンは以下の式 (1.3) で表される. ここで A はエネルギース ケールを表し, κ は二つの相互作用の比である. 式 (1.3) の右辺の第一項は光子を伴う過 程を示しており, 図1.2 に示すように,実光子として放出されれば $\mu \rightarrow e\gamma$ の崩壊に,仮想 光子として原子核に結合すればミューオン・電子転換過程 $\mu N \rightarrow eN$ となる. ミューオン・ 電子転換過程は $\mu \rightarrow e\gamma$ を内包している. また,式 (1.3) の右辺の第二項は終状態に光子 を伴わない過程 (図 1.3) を表し, $\mu \rightarrow e\gamma$ では観測することができない.

$$L = \frac{m_{\mu}}{(\kappa+1)\Lambda^2} \bar{\mu}_R \sigma^{\mu\nu} e_L F_{\mu\nu} + \frac{\kappa}{(\kappa+1)\Lambda^2} \bar{\mu}_L \gamma^{\mu} e_L(\tilde{q}_L \gamma_\mu q_L)$$
(1.3)

2つのパラメータ, Λ と κ は説明するモデルによって変化し,標準模型を超える新しい物 理モデルの検証が可能となるため重要なパラメータである. cLFV 過程の探索によって到達 できるエネルギースケールは 10³ TeV にもなり,直接加速器で到達できない高エネルギー の物理現象の探索が可能であることが分かる.

1.3 ミューオン・電子転換過程

物質中で μ^- が静止すると、 μ^- は物質中の原子核のクーロン場に束縛され、 ミューオニック原子が形成される. 束縛された μ^- は X 線を放出しながら基底状態である 1S 軌道まで落ちていく. その後 μ^- は、式 (1.4)の標準模型の枠内では原子核軌道上で崩壊するか、式 (1.5)の原子核に捕獲されるミュー粒子原子核捕獲反応かのいずれかの過程をたどる.

$$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \tag{1.4}$$

$$\mu^{-} + (A, Z) \to \nu_{\mu} + (A, Z - 1)$$
 (1.5)

ここで、Aは μ^{-} が束縛された物質の原子量、Zは原子番号を表す.式(1.4)のような過程を Decay in Orbit (DIO)、式(1.5)のような過程を Muon Capture (MC) と呼ぶ. ミューオンの寿命 τ は式(1.6)から求め、式(1.7)で表される.

$$N = N_0 e^{-(\alpha_f + \alpha_c)t} \tag{1.6}$$

$$\tau = \frac{1}{\alpha_f + \alpha_c} \tag{1.7}$$

ここで、*N* は時間 *t* に残っているミューオンの数、*N*₀ は最初 (*t* = 0) にあったミューオン の数である.また、 α_f は DIO の崩壊定数であり、自由空間でのミューオンの Michel 崩壊と 同様で、 $\alpha_f = 0.452 \,\mathrm{s}^{-1}$ である.崩壊定数の逆数は自由空間でのミューオンの寿命であり、 2.197×µsである. α_c は MC の崩壊定数であり、ミューオンと原子核の波動関数の重なりに依 存するため、物質の原子番号によって大きく異なる.炭素 (C) の場合、 $\alpha_c = 0.0388 \times 10^6 \,\mathrm{s}^{-1}$ である.したがって、C 原子に束縛されたミューオンの寿命は $\tau = 2.02 \,\mathrm{µs}$ 、物質中でのミュー オンの寿命は自由空間でのそれよりも小さくなることがわかる.実験のデザインにおいて、



図 1.2: 光子を伴うミューオン・電子転換過程のファインマンダイアグラム



図 1.3: 光子を伴わないミューオン・電子転換過程のファインマンダイアグラム

ミューオンの寿命は非常に重要である.ミューオン・電子転換過程はミューオンと原子核の 重なりに依存する反応であるため,その分岐比はミューオン原子核捕獲の崩壊幅に対する ミューオン・電子転換過程の崩壊幅を用いて次のように定義される.

$$Br(\mu^{-} + (A, Z) \to e^{-} + (A, Z)) \equiv \frac{\Gamma(\mu^{-} + (A, Z) \to e^{-} + (A, Z))}{\Gamma(\mu^{-} + (A, Z) \to \nu_{\mu} + (A, Z - 1))}$$
(1.8)

1.4 ミューオン・電子転換仮定のシグナルとバックグラウンド

ミューオン・電子転換過程が起こった場合,単色エネルギー $E_{\mu e}$ をもつ電子が原子核から放出される.そのエネルギーは、ミューオンの質量 m_{μ} から、ミューオニック原子中での1S 軌道における束縛エネルギー B_{μ} と原子核の反跳エネルギー E_{rec} を引いたものとなる. 原子核の反跳エネルギー E_{rec} は、原子核の質量 M_{A} を用いて式(1.9)のように近似できるが、反跳エネルギー E_{rec} は十分小さいため、無視することで式(1.10)のように近似することが出来る.

$$E_{\rm rec} \approx \frac{(m_{\mu} - B_{\mu})^2}{2M_{\rm A}} \tag{1.9}$$

$$E_{\mu e} = m_{\mu} - B_{\mu} - E_{\rm rec} \approx m_{\mu} - B_{\mu}$$
 (1.10)

1S 軌道の束縛エネルギー B_{μ} はミューオニック原子をつくる原子によって異なるため,実験に用いる標的物質によってミューオン・電子転換過程由来の電子のエネルギー $E_{\mu e}$ の大きさも異なる. C原子の場合では 105.06 MeV となる. ミューオン・電子転換探索実験において,前述の DIO は主なバックグラウンド源となる. 図 1.4 に Czarnecki らが行った原子核の反跳の効果や,原子軌道に束縛されたミュー粒子の相対論的な効果等を考慮して計算された DIO 電子の予想運動量スペクトルを示す [10]. DIO 電子は原子核の反跳により 105 MeV /c 付近の高い運動量域にも生じるため,主なバックグラウンドとなる. しかし,図 1.4 のように C 原子の $E_{\mu e}$ である 105 MeV 近傍で急激に減少しており,十分な運動量分解能を持った測定器を用いることによって,ミューオン・電子転換電子と DIO 電子の区別が可能である.

他の主なバックグラウンドとして、即発電子が考えられる.即発電子バックグラウンドと は、一次陽子ビームが陽子標的に入射したとき生成される様々な即発二次粒子のうち、*E_{µe}* と同じエネルギーを持った電子の事である.陽子ビームが標的に入射したタイミングで発生 するため、遅延して出てくるミューオン・電子転換の電子とを分ける事が出来る.ただし遅 延タイミングに一次陽子が存在すると、遅れた一次陽子による即発電子をミューオン・電子 転換の電子と間違える可能性が予想される.このようなパルス陽子ビームから遅れて陽子 標的に入射する陽子を Delayed proton と呼ぶ. DeeMe 実験においてはこのような Delayed proton の少ない高純度なパルス陽子ビームを用いることが重要である.



図 1.4: Czarnecki らによる DIO 電子のエネルギースペクトル. Si (青), C (赤). 赤線を見 ると μ-e 転換電子の運動量である 105 MeV/c 付近まで分布していることが分かる.

2 実験計画

ミューオン・電子転換過程探索実験 DeeMe (Direct electron emission from Muon – electron conversions, DeeMe) は茨城県東海村にある J-PARC の物質・生命科学実験施設 (Material and Life Science Experimental Facility, MLF) で行なわれるミューオン・電子転換過程の観 測を目指す実験である. 以下に J-PARC にある設備,および実験計画について述べていく.

2.1 J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex)

図 2.1 に J-PARC の鳥瞰図を示す. J-PARC は,日本原子力研究開発機構 (JAEA)と高 エネルギー加速器研究機構 (KEK)が共同で運営している大型加速器施設である [12].高強 度の陽子ビームを標的に当てて生成させた様々な二次粒子(中性子,ミューオン,K中間 子,ニュートリノなど)ビームを活用することで素粒子物理,原子核物理,物質科学,生命 科学,原子力工学などの多くの分野の基礎から応用まで広い範囲の研究が行われている.

J-PARC は3台の加速器 Linac, 3 GeV RCS, 30 GeV MR から構成されている. Linac では負水素イオンを最大 50 Hz で 400 MeV まで加速し RCS と超伝導リニアックビームラ インの2つに 25 Hz で振り分ける. RCS (Rapid Cycling Synchrotron) では負水素イオンを 陽子ビームに変換し,リング内で周回させ 3 GeV まで加速させ MLF と MR に振り分け る. MR では RCS から送られる陽子を 30 GeV まで加速させる.



図 2.1: J-PARC 鳥瞰図

2.1.1 Linac

Linac では、負水素イオン源で負水素イオン H⁻ を発生させ、そのエネルギーを 600 MeV まで加速する. 最大 50 Hz の繰り返しでパルス運転され、400 MeV まで加速された時点で、 RCS へのビームラインと、さらに加速する超伝導リニアックビームラインの 2 つにそれぞ れ 25 Hz で振り分けられる.

2.1.2 RCS (Rapid Cycle Synchrotron)

線形加速器から取り出された 400 MeV の負水素イオン H⁻ を,荷電変換用炭素皮膜を用 いて電子を2 つ剥ぎ取り,陽子 H⁺ ビームに変換して入射する. その後,約20 msec で RCS 一周を 15,000 回程度周回させる. H⁺ ビームは周回毎に高周波加速空洞で加速され,最終 的に 3GeV まで加速される. そして下流にあるビーム輸送系を通じて,物質・生命科学実験 施設 MLF と, MR(Main Ring) へ輸送される. RCS から MLF へは「速い取り出し」と呼 ばれる方法で取り出される.

原理的には取り出し後のリング内に陽子は残らず, delayed proton によって生成される即 発電子のバックグラウンドを抑えられると期待される. RCS は3 GeV まで加速するのにわ ずか 20 msec しかかからないため, 1 秒間に 25 回もの新しいビームを加速することができ, 平均電流 333 μA, 電力 1 MW が可能となった. RCS の基本的なパラメータは表 2.1 に示す 通りである.

| 周長 | 348.3m |
|---------|--------------------|
| 入射エネルギー | 400 MeV |
| 出射エネルギー | $3 { m GeV}$ |
| 繰り返し運転 | 25 Hz |
| バンチ数 | 2 |
| ビーム強度 | 800 kW (2023年4月現在) |

表 2.1: RCS パラメータ一覧

2.1.3 MR(Main Ring)

RCS から取り出されたビームの一部は,続けて MR に入射される. このビームは,1周 を約2秒かけて 32万回ほど周回し,3 GeV から 30 GeV へと加速される. 加速された後こ の陽子は,ハドロン実験施設・ニュートリノ実験施設へと送られる.

2.1.4 MLF (Material and Life Science Experimental Facility)

MLF は物質・生命科学実験施設の英略語である. MLF は図 2.1 のように MR の中央に 位置する. RCS で生成された陽子ビームの 92%をこの MLF で利用する. 陽子ビームを標 的に当て中性子ビームやミューオンビームを生成しそれぞれの実験室に輸送する. 図 2.5 は, MLF のビームラインを示している. 図 2.4 に RCS で生成されるビーム構造を示す.

2.2 DeeMe実験

DeeMe 実験 [1] では,陽子標的とミューオン静止標的は 1 枚の標的に置き換えられている. Surface muon は,陽子標的中で生成された超低エネルギー π^+ が生成直後にそのまま陽子 標的の表面付近に静止し,これが $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$ 崩壊をすることによって発生する μ^+ である.



図 2.2: RCS からくる陽子ビーム構造

しかし, Surface μ^- というものは存在しない. μ^- の親となる π^- は物質中で静止するとす ぐに原子核に捕獲されてしまうため, $\pi^- \rightarrow \mu^- \nu_{\mu}$ 崩壊ができないからである. その代わり, ミューオン生成標的に止まり損ねて近傍の空間を低速で飛行する π^- からの崩壊によって生 じる Cloud μ^- が存在する. Cloud μ^- は Surface μ^+ の約 2%程度は存在することが分かっ ている. 陽子標的中で大量生成されている低エネルギーの π^- の中には, 陽子標的中で μ^- に in-flight 崩壊 (飛行中に崩壊) するものもあると期待でき, そうして生まれた μ^- の一部 は陽子標的中で静止する可能性がある. これが事実であるならば, 陽子標的からミューオン 静止標的までをたった1枚の陽子標的に置換することが可能である.



図 2.3: DeeMe 実験の全体図 [1]

この事実を確認するための実験が、2009 年 MLF の D2 ビームラインで実施された [?]. ビームラインの運動量を 40 MeV/c にし、パルス陽子ビームから遅延したタイミングで輸送される遅延電子をカウントしたところ、陽子標的中に静止している μ^- の収量が陽子強度 1MW に換算すると、10¹⁰/sec もあることを実証した.この事実より、「一次陽子標的中に静止した μ^- を直接利用して μ^-e 転換の証拠を掴む」というアイデアが実現可能であることが わかった.これにより、コンパクトで低コストな実験が可能になる.

1次陽子標的中の大量のミューオニック原子から放出された電子は、2次ビームラインを 用いて電子スペクトロメータまで輸送される.二次ビームラインによって低エネルギーの バックグラウンドは取り除かれる.さらに電子は磁気スペクトロメータまで輸送され、運動 量が測定される.

DeeMe グループは、炭素製標的を用いて実験を始め、1MW 陽子ビーム、 2×10^8 sec の ビームタイムで、オーダーで 10^{-13} 程度の単一事象感度を目指す. 図 2.4 にパルス陽子ビー ムの時間構造と DeeMe 実験における信号探索時間を示す.パルス陽子ビームは2バンチ構造となっており,ビーム間は600 ns,繰り返し40 msで標的に入射する.前述のように,μ-e 転換過程による電子は,ビーム入射後1 μs 程度遅延して出てくる.そのため,信号探索領域は2バンチ目が入射してから300 ns後の2 μsに設定している.



図 2.4: パルス陽子ビームの時間構造と DeeMe 実験における信号探索時間

2.2.1 H-line (High-momentum muon beamline)

MLF 内のミューオンビームラインがあるエリアを図 2.5 に示す. ミューオンを生成するた めのターゲットから4つのビームラインに分岐しており, S-line, D-line, U-line, H-line が ある. H-line は H1 エリアへとミューオンを輸送するために建設された全長 21 m のミュー オンビームラインで bending point が 2 カ所あり, 任意の運動量の粒子を取り出すことがで きる. 構成は大口径キャプチャーソレノイド HS1, 双極磁石 HB1, HB2, 輸送ソレノイド HS2, HS3, 四重極磁石 HQ1, HQ2, HQ3 である (図 2.6).

ミューオンを生成するためのグラファイト製標的に陽子ビームが当てられた際,生成され る荷電粒子の瞬間的な計数率は 10¹⁴ Hz にも達する. H-line は任意の運動量の粒子を選び 出せるので大量の粒子から飛跡検出器を保護することができる. ビームは最下流の四重極磁 石を通過した後実験室へと輸送される. H-line を上から見た様子は図 2.7 である.

H-Line は DeeMe 実験の他にも、ミューオンについての基礎物理学研究への活用が期待 されている. 前述のようにパルス陽子ビームが標的に照射されると π^+ が生成されるが、こ れが崩壊することで Surface muon (μ^+ ,約 28 MeV/c) となる. 105 MeV/c の電子を用いて 実験を行う DeeMe に対し、以下の実験はこの約 28 MeV/c の Surface muon で実験を行う.

このビームラインでは 105 MeV/c の e^- を用いる DeeMe 実験と 28 MeV/c の μ^+ を用 いる g-2/EDM 実験, MuSEUM 実験が行われる.

DeeMe 実験

μ-e 転換過程の探索,荷電レプトン・フレーバー非保存過程の探索



図 2.5: MLF H1 エリア



図 2.6: G4beamline で描かれた H-line

g-2/EDM 実験

MuSEUM 実験

ミュオニウム基底状態の超微細構造の精密測定を目指している(図 2.9).



図 2.7: H-line を上から見た様子. 上部が下流側



図 2.8: g-2/EDM 実験の概要



図 2.9: MuSEUM 実験の概要

2.2.2 H-line ビーム出口詳細

図 2.10 にビーム出口を示す. 出口表面には Vacuum shield としてカプトンフィルムが張られている. また気圧によるフィルムの落ち込みを軽減するためステンレスの網が張られている. 上部にビームを遮断するブロッカーがついている.



図 2.10: H-line を実験室から見た様子

2.2.3 DeeMe 実験における物理解析とバックグラウンド

DeeMe 実験におけるバックグラウンドについてまとめる. DIO 電子

DIO で放出される電子の運動量はシグナル領域まで到達する可能性があるが、105 MeV/c のシグナルに対して 1 MeV/c 以下の運動量分解能があればシグナルとの区別は可能である.

DP バックグラウンド

Delayed Proton (DP) とは、RCS 加速器からの正規の取り出しタイミングより遅れて取り出されてしまう一次陽子によるバックグラウンドである.シグナル電子の遅延と同じタイ

ミングで,DP から電子が発生するとバックグラウンドとなる.メイン陽子と信号探索時間 領域 2 µs の間の DP 数の比を Rate of Delayed Proton (RDP) と定義する. ビームロスモニ ターで DP を測定した結果, $RDP < 2.1 \times 10^{-19}$ となった.1 年間のビームタイムあたりの DP バックグラウンド数は NDP < 0.004となり十分に小さいという結果が得られた [11].

宇宙線起源によるもの

信号探索時間は RCS からのパルス陽子ビームの繰り返しである 40 ms 中の数 µs で あるため、 $2 \times 10^7 s$ のデータ取得時間で再構成される宇宙線起源のバックグラウンドは約 5×10^{-5} event に抑えられるとされている [1].

2.3 陽子標的兼ミューオン静止標的

2023年1月現在,MLFで使用されているミューオン生成標的は,グラファイト製の回転 標的が使用されている(図 2.11). この標的は内径 23cm,外径 33 cm,厚さ 2 cmのドーナ ツ型円盤である.他のミューオンの cLFV(荷電レプトンフレーバー非保存)過程探索実験 では,Ti(チタン,Z=22)やAu(金,Z=79)が使用されている.しかし,DeeMe実験で はこれらの標的を使用しない理由は,1 MWの陽子ビームに対する熱耐性が不足している ことである.TiC 製標的も検討されたが,ミューオニック Ti原子から出るミューオン・電 子転換電子のエネルギーは約 104.4 MeV であり,このエネルギーのシグナルは DIO 電子に 埋もれてしまうためである.

2.4 H1 エリア

H-Line の建設に伴い,実験を行う場所として H1 エリアが建設された(図 2.12). DeeMe はこの H1 エリア内で実験を行っており,今後は MuSEUM も利用を開始する予定である. また,2023 年 1 月現在,H2 エリアが建設中であり,これは g-2/EDM が利用予定である.

2.4.1 磁気スペクトロメータ

電子の運動量の精密測定を行うため,H-Lineの下流に磁気スペクトロメータが設置されている(図 2.13).磁気スペクトロメータは PACMAN と呼ばれる双極電磁石と4台の飛跡検出器から成り立っている(図 2.14).4台の飛跡検出器のうち,2台は電磁石の上流に,残りの2台は下流に配置されており,それぞれの間にはヘリウムで満たしたバッグがあり,空気による散乱を抑えている.

磁気スペクトロメータの原理について考えると、PACMANと座標系を示す図 (2.15)を使用する. 荷電粒子は写真の手前から奥に向かって進む. 磁場は y 軸方向の成分のみを一様に持つと仮定し、荷電粒子は xz 平面を円運動する. 相対論的な荷電粒子が一様な磁場中を円運動するとき、荷電粒子の静止質量を m_0 、速さをv、円運動の半径をr、光速度をc、電荷 をq、磁束密度をBとすると、ローレンツ力が向心力と等しいので、次のように表される.

$$\frac{m_0 v^2}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = qvB \tag{2.1}$$



図 2.11: グラファイト製回転標的



図 2.12: H1, H2の俯瞰



図 2.13: 磁気スペクトロメータ. 右側がビーム上流, 左側がビーム下流である.



図 2.14: DeeMe 実験に用いられる飛跡検出器 MWPC



図 2.15: DeeMe 実験に用いられる双極電磁石 PACMAN

この式(2.1)を変形すると、次のようになる.

$$r = \frac{1}{cqB} \frac{cm_0 v}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$
(2.2)

この式 (2.2) に光速度 c (約 3 × 10⁸ m/s),電荷 q (約 1.6 × 10⁻¹⁹ C),磁束密度 B (約 0.4 T),運動量 $m_0 v / \sqrt{1 - (v/c)^2}$ (約 105 MeV/c)を代入すると、次のようになる.

$$r = \frac{1}{3 \times 10^8 \,\mathrm{m/s} \cdot 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C} \cdot 0.4 \,\mathrm{T}} \cdot c \cdot 105 \,\mathrm{MeV/c}$$
(2.3)

$$= \frac{1}{3 \times 10^8 \,\mathrm{m/s} \cdot 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{A} \cdot \mathrm{s} \cdot 0.4 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{A}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-1}} \cdot 105 \,\mathrm{MeV}$$
(2.4)

$$= \frac{1}{3 \times 10^8 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \cdot 0.4 \,\mathrm{N}} \cdot 105 \cdot 10^6 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{N \cdot m}$$
(2.5)

$$\approx 0.88 \,\mathrm{m}$$
 (2.6)

したがって,105 MeV/c の運動量を持つ電子は,0.4 T の一様な磁場中で約0.88 m の曲 率半径で円運動する.この円運動により電子は約70 度曲がり,それに合わせて MWPC の 設置場所が決定される.

2.4.2 双極電磁石 (PACMAN)

磁気スペクトロメータの磁場をかけるために,双極電磁石 PACMAN が使用されている (図 2.13). この電磁石は,カナダの国立研究所 TRIUMF で行われた正パイ中間子の陽電 子と正ミューオンへの崩壊の分岐比を測定する実験(PIENU 実験)にも使用されている. PACMAN は 2014 年 8 月に TRIUMF から J-PARC MLF まで運ばれた. PACMAN の仕様 は表 2.2 に示されている.

| Current (Max) | 500 A |
|----------------------|--------------------|
| Magnetic field (Max) | $0.68 \mathrm{~T}$ |
| Length | $2350~\mathrm{mm}$ |
| Height | $2500~\mathrm{mm}$ |
| Width | $700 \mathrm{~mm}$ |
| Mass | $29.5~{\rm t}$ |
| Inductance | $100 \mathrm{~mH}$ |

表 2.2: PACMAN 電磁石の仕様

2.4.3 飛跡検出器 (Multi Wire Proportional Chamber)

DeeMe 実験で用いる飛跡検出器は, MWPC (Multi Wire Proportional Chamber) である (図 2.14). 図の黄色の四角部分が大きさ 260 mm, 正方形の検出面である. DeeMe 実験で の要求が 2 つあり, 即発バーストパルスに対する耐性 (およそ 70 GHz/mm²)を持つこと と, 即発バーストパルスを受けた数百ナノ秒後に, 一個の電子を検出できることである. こ れらの要求を満たすため, DeeMe 独自の特徴として, アノードワイヤー間にポテンシャル ワイヤーが張られている (図 2.16). 即発粒子が輸送されてくるタイミングでポテンシャル ワイヤーに電圧をかけることによって, 荷電粒子による信号のゲインを小さくでき, 遅延粒 子が輸送されてくるタイミングで電圧を 0 V にすることによって, ゲインを大きくするこ とができる. これにより, 即発バーストパルスが検出器を通過するとき空間電荷効果を防ぐ ことができる. [13]



図 2.16: DeeMe の MWPC の断面図

3 運動量校正粒子

DeeMe 実験では双極磁石と 4 台の MWPC で校正される磁気スペクトロメータを用いて 到来粒子の運動量を再構成する.運動量校正を行うには運動量がよく知られた粒子を用い る.また,バックグラウンドとなる大量の即発粒子が含まれているタイミングを避けた遅延 粒子を利用する.そこで μ -e 転換過程電子の運動量 105 MeV/c よりも低運動量で良く知ら れているのは π_{e2} 崩壊からの単色陽電子 69.83 MeV/c および Michel 崩壊からの連続分布陽 電子の最大運動量,Michel Edge (52.8 MeV/c) である.K 中間子崩壊に伴う陽電子も 105 MeV/c よりも高い 247 MeV/c に存在するが,DeeMe 磁気スペクトロメータの最大運動量 より大きいために利用は難しい.

3.1 1次粒子の利用

DeeMe 実験では標的から直接出る遅延電子を H-Line で輸送し,磁気スペクトロメータで 測定する. 2023 年現在, MLF のミュオンセクションで運用されているグラファイト標的か ら生成される粒子を H-Line で輸送し,測定することで大強度ビーム下でのビーム測定の理 解を深めながら運動量校正を進める.

3.1.1 Michel 崩壊

陽子ビームがグラファイト標的に当たると π^+ が生成され, μ^+ に崩壊する. この μ^+ は 2197 ns の寿命で陽電子に崩壊する.

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \tag{3.1}$$

$$\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \bar{\nu_\mu} \tag{3.2}$$

この μ⁺ の崩壊は特に Michel 崩壊と呼ばれ,崩壊時には最大運動量 52.8 MeV/c の運動量 分布(図 3.1)をもつ.しかし,この崩壊陽電子はグラファイト標的から脱出する際エネル ギー損失を伴うため,運動量分布が変化する.これは後に述べる.

3.2 2次粒子の利用

パイ中間子等の寿命が短い粒子を利用する場合,標的から直接来る粒子は即発粒子などの バックグラウンドに埋もれてしまうため,検出効率が悪くなってしまう.そこで標的からの 粒子を直接測定する方法の他に計数率を下げつつ目的粒子を検出しやすくするアイデアと して,H-lineの途中に校正用試料を設置して粒子を静止,崩壊させた2次粒子を利用する方 法がある(図 3.2).

校正用試料は HB2 前方に配置される.理由としては HB2 上流部 HS1–HS3 の運動量を HB2–HQ3 の運動量よりも低く設定することにより、ミュオン標的から直接 DeeMe スペク トロメータに飛来する大量の即発粒子を抑制できるためである.



図 3.1: Michel 崩壊陽電子の運動量分布(崩壊時)

3.2.1 π_{e2} 崩壊による陽電子

グラファイト標的地点での π_{e2} 崩壊からの単色陽電子 69.83 MeV/*c* を利用する場合,パ イ中間子の寿命が 26 ns と短いため, π_{e2} 崩壊で放出される単色陽電子は陽子パルスビーム とほぼ同時に発生する.

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \tag{3.3}$$

このタイミングには π⁰ 崩壊や電磁相互作用などを起源とする連続運動量分布をした陽電子 も大量に存在してバックグランドとなっており, π_{e2} 単色陽電子はこのバックグランドに埋 もれてしまって観測が難しい.そこで校正用試料としてアルミニウム板を用いる.サイズは 厚さ 1 mm, 300 × 300mm² を用いる.グラファイト標的から 40 MeV/c の π⁺ 中間子を輸送 し,校正用試料で静止させる.校正用試料を用いることで,標的からの直接のバックグラウ ンドを抑制し,校正標的で発生する π_{e2} 崩壊陽電子の単色ピークだけを観測することが現実 的となる.

3.2.2 Michel 崩壊による陽電子

$$\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \bar{\nu_\mu} \tag{3.4}$$

Michel 陽電子を用いる測定では,校正用試料としてカプトンを用いる.規格は厚み 50 µm, 幅 2 mm,高さ 300 mm のものを用いる.グラファイト標的から 10 MeV/cの µ⁺ を輸送し, カプトンストリップで静止させる.校正標的の大きさを小さくすることによりビーム中の µ⁺ の一部のみを静止させることができる.校正標的に静止しない µ⁺ は HB2 内壁に静止す ることになるが,ビーム軸から外れているので HB2 壁面で発生する Michel 陽電子が H1 エ リアに到達することはないと考えられる.校正標的で発生する Michel 陽電子だけが DeeMe スペクトロメータに到達するので,スペクトロメータの計数率を低く抑えることが可能とな



図 3.2: 校正用試料の配置場所について

る. 標的の厚さも最適化できるので,エネルギー損失の程度をコントロールすることが可 能である.

4 モンテカルロシミュレーション

G4beamline モンテカルロシミュレーションを用いて,H-Line で輸送される粒子をシミュ レーションする.運動量校正を行う上でどのような運動量分布が得られるかを知るためにま ず,グラファイト標的へ陽子ビームを当てるシミュレーションを G4-beamline を用いて行 う.G4-beamline は Geant4 をベースとした粒子追跡シミュレーションプログラムであり, モンテカルロ法を用いて物質中における粒子の飛跡をシミュレーションする.仮想空間内で 様々な形状・素材のオブジェクトを生成することができ,ビーム粒子の種類やエネルギーな どを自由に決めることができる.

シミュレーションを行なう手順は以下の通りである.

1. グラファイト標的に陽子を当てる

- 2. 統計量を稼ぐために水増しする
- 3. 2次ビームライン H-Line で輸送する
- 4. 磁気スペクトロメータで運動量再構成する

4.1 グラファイト標的で生成される粒子

H-Line に入射する荷電粒子のガンファイルを生成するため、グラファイト標的に陽子ビームを当てる. POT 10¹⁰ で 3 GeV の陽子ビームを陽子標的兼ミューオン静止標的に入射させ、H-Line のキャプチャーソレノイド側に出てきた粒子を解析する. Graphite 標的は厚さ20 mm,内径 91 mm,外径 168 mm,密度 2.26 g/cm³の設定で数値計算を行った.表4.1 に入射陽子 1 つあたりで入射から200 nsec 以内に炭素標的から出てくる粒子の種類と数の結果を示す. 一般に即発粒子と呼ばれる粒子群が大量に発生する. また表4.1 のうち、 π 中間子, μ 粒子,電子,陽電子の運動量分布は図4.1,4.2,4.3,4.4 のようになる.

表 4.1: 炭素標的から出てくる粒子の種類と数(POT 10¹⁰ 入射から 200 nsec 以内)

| 粒子 | Event 数 | Event/proton | 粒子 | Event 数 | Event/proton |
|------------|----------|-----------------------|------------------|---------|-----------------------|
| р | 32258524 | 3.23×10^{-3} | K^+ | 65651 | 6.57×10^{-6} |
| n | 78477858 | 7.85×10^{-3} | K^0_L | 23568 | 2.36×10^{-6} |
| π^+ | 16433133 | 1.64×10^{-3} | ${ m K}^0_S$ | 13 | 1.30×10^{-9} |
| π^{-} | 8975134 | 8.98×10^{-4} | K^- | 786 | 7.86×10^{-8} |
| e^- | 4566850 | 4.57×10^{-4} | D | 622465 | 6.22×10^{-5} |
| e^+ | 2769476 | 2.77×10^{-4} | Т | 48402 | 4.84×10^{-6} |
| μ^+ | 345438 | 3.45×10^{-5} | ³ He | 13076 | 1.31×10^{-6} |
| μ^- | 178062 | 1.78×10^{-5} | α | 57849 | 5.78×10^{-6} |
| γ^- | 3639340 | 3.64×10^{-4} | Λ^0 | 271 | 2.71×10^{-8} |

DeeMe では磁気スペクトロメータで 105 MeV/c を大きく超える粒子を測定する予定はな いが,標的では 105 MeV/c を大きく超える粒子が大量に作られていることが分かった.グ



図 4.1: 標的の外に出てきた π^- の運動量分布, <200 ns



図 4.2: 標的の外に出てきた π^+ の運動量分布, <200 ns



図 4.3: 標的の外に出てきた μ^- の運動量分布, <200 ns



図 4.4: 標的の外に出てきた µ⁺ の運動量分布, <200 ns



図 4.5: 標的の外に出てきた電子の運動量分布, <200 ns



図 4.6: 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布, <200 ns

ラファイト標的へ陽子ビームが入射してから 200 ns 以降に標的外へ出てくる粒子は表 4.2 に 示す. また表 4.2 のうち電子,陽電子の運動量分布は図 4.7,4.8 のようになる.主にミュー オンなどの長寿命の粒子から生まれた崩壊電子および崩壊陽電子が見えている.

表 4.2: 炭素標的から出てくる粒子の種類と数(入射陽子1つあたり, 入射から 200 nsec 以降)

| 粒子 | Event 数 | Event/proton |
|--------------|---------|----------------------|
| e^- | 31945 | 3.19×10^{-6} |
| e^+ | 984937 | 9.85×10^{-5} |
| μ^+ | 6 | $6. \times 10^{-10}$ |
| γ^{-} | 233354 | 2.33×10^{-5} |



図 4.7: 標的の外に出てきた電子の運動量分布, >200 ns

4.2 輸送粒子の水増し

モンテカルロシミュレーションでは信頼性や誤差の評価のために試行回数が十分多いこと が重要である. 粒子の輸送シミュレーションを行なう上ではビームラインの下流側になるに つれ輸送粒子数が減少することがあり,全体の傾向を把握できる十分な統計量を確保する必 要がある. 粒子数の水増しはこの問題を解決する1つの手段であり,粒子の水増しとはオリ ジナルのガンファイルがもつ物理量の情報を複数取り出し,それらを基に新たなイベントを 複数生成する. 水増しを行なう上でオリジナルの粒子の特徴や全体の傾向を損なわず複製す ることが重要となり,特に位置,運動方向,運動量分布,到来時間分布の間それぞれの相関 を考慮し,強い相関がある場合はそれらを保存する必要がある.



図 4.8: 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布, >200 ns

4.2.1 target 水増し

target 水増しとは標的内で崩壊する粒子の位置から崩壊生成物をガウス分布で揺らしなが ら水増しする方法で、単一事象感度 (Single-Event Sensitivity, SES) の評価を過去行なっ た際に利用されている.

4.2.2 MSR 水増し

MSR(Momentum scale Random) 水増しは, target 水増しと異なり主にビームライン途中 の粒子を水増しする際にオリジナルの粒子がもつ物理量の相関性を保つための水増し方法で ある. target 水増しでは粒子の位置 [x, y, z] を基に信号粒子を水増し生成していたが, MSR 水増しではその粒子の種類 [pid], 位置 [x, y, z], 各方向の運動量 [px, py, pz], 時間 [t] を各 イベント毎に1セットで抽出する. 取り出した1イベントのうち位置 [x, y], 運動量 [p], 時 間 [t] をガウス分布で揺らす. 運動量は水増し基ガンファイルの運動量 [px, py, pz] から計算 する.

4.3 水増しの妥当性評価

MSR 水増しで水増し基の特徴をどの程度保持できるかを確認する. 位置 [x, y],運動量 [p],時間 [t] に対してガウス分布 $\sigma = 0.25$ で揺らす. 輸送前の粒子数が 984937 event で 4999996 event に水増しした.水増し前と水増し粒子の結果を比較し,どの程度全体像に違 いがあるかを確認する. 粒子の位置,運動量方向,時間,運動量分布を確認する.

運動量分布,時間,位置,運動方向と位置に関する特徴は保持されていることが分かる. 次に,このガンファイルを H-line 輸送し,出口での結果がどの程度異なるか確認する.

2次ビームライン H-Line で輸送する.水増しした粒子を H-Line 輸送し H1 エリアにやっ てくる粒子を G4beamline シミュレーションにより評価する.輸送の様子を示したものが図 4.11 であり,赤線が電子,緑線が光子の軌跡を表している.



図 4.9: [MSR 水増し前] 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布,時間分布,位置分布,運動方向 >200 ns



図 4.10: [MSR 水増し後] 標的の外に出てきた陽電子の運動量分布,時間分布,位置分布,運動方向 >200 ns



図 4.11: Michel 崩壊陽電子の H-Line 輸送シミュレーション

MSR 水増しの基ファイルとの比較のために Michel 崩壊陽電子を ID30 設定(図 4.3) で H-line 輸送する.ここで ID~とは H-Line の電磁石を動作させるために設定する電流値設定 の名称である. ID30 は正電荷で中心運動量 50 MeV/c の粒子を輸送するために設定した各 電磁石の電流値である.H-Line 出口までの輸送結果を図 4.12, 4.13 に示す.

表 4.3: ID30 の各マグネットの電流値

| 電磁石 | 電流値 |
|--------|--------------|
| HB1 | 169.89 A |
| HS2 | 69.12 A |
| HS3 | 77.72 A |
| HB2 | $186.20 \ A$ |
| HQ-1 | 78.70 A |
| HQ-2 | $146.86 \ A$ |
| HQ-3 | $112.29 \ A$ |
| PACMAN | $142.85 \ A$ |

輸送される粒子の中心運動量は水増し前が 48.95 MeV/c に対し,水増しが 48.81 MeV/c で 0.29%減少した.輸送粒子数は水増し前が 195 event に対して水増しが 981 event であっ た.輸送前の粒子数が 984937 event で 4999996 event に水増ししたため,数の比較には水 増し換算が必要である.水増しの計数は 5.07 倍 であるため,水増しした方を補正すると 193 event となる.水増し基と比較すると 1.0% 減少したことが分かる. MSR 水増しは粒子 がもつ位置と運動量,輸送粒子数の評価に関して,水増し基の傾向を大きく損なうこと無く 複製することができる.時間に関してはオリジナルの特徴を再現できているとはいえない が,これは水増し基の統計量が少ないためであると考えられる.このように水増し元に十分 な統計量がない場合,レアイベントを強調してしまう可能性がある.



図 4.12: [MSR 水増し前]H-line 出口まで輸送された Michel 陽電子の運動量分布,時間分布, 位置分布と運動方向 >200 ns



図 4.13: [MSR 水増し後]H-line 出口まで輸送された Michel 陽電子の運動量分布,時間分布, 位置分布と運動方向 >200 ns

5 グラファイト標的由来の Michel 陽電子

校正用粒子としてグラファイト標的で生成される Michel 崩壊陽電子を利用する方法を述べる.

5.1 グラファイト標的由来 Michel 陽電子の輸送シミュレーション

グラファイト標的由来の Michel 崩壊陽電子の運動量を標的内輸送シミュレーションにより評価する.標的内で Michel 崩壊陽電子の運動量分布に従い陽電子を 1e8 event 水増し生成させる.粒子の初期方向は等方に設定し,H-Line 入り口方向に出てきた陽電子の運動量分布をみる(図 5.1).



図 5.1: 水増し生成したグラファイト標的由来の Michel positron と間接的に発生した陽電 子の運動量分布

グラファイト標的由来の Michel positron 運動量分布は脱出時のエネルギー損失により, 52.8 MeV/cの最高運動量のエッジ部分が 35 52.8 MeV/cの低運動量側になまった形状にな る. 続いて H-line 輸送を行い,この最高運動量を見ることが出来るかを確認する.

5.2 H-line 輸送

H-Line の輸送運動量設定を 50 MeV に設定し,再構成された運動量分布を比較する(図 5.2). H-Line を構成する各マグネットの電流値は表 5.1 の通りとする. この電流値設定を ID2 とする. また HS1a, b, c の電流値は [1500, 1500, 0 A] とする.

表 5.1: ID2 の各マグネットの電流値

| 電磁石 | 電流値 |
|--------|-------------------|
| HB1 | $170.90 { m A}$ |
| HS2 | $67.3 \mathrm{A}$ |
| HS3 | 80.3 A |
| HB2 | 187.10 A |
| HQ-1 | $105.60 {\rm A}$ |
| HQ-2 | 128.16 A |
| HQ-3 | 69.93 A |
| PACMAN | $142.85 \ A$ |



図 5.2: 磁場 ID2 で再構成された運動量の分布 (Prompt timing から 200 sec 以降のもの)

ID2 での輸送結果から中心運動量 50 MeV/c の陽電子が輸送されていることが確認された.しかし,運動量分布の形状が,H-line 輸送の運動量選択によるものか,Michel 崩壊陽電子のエッジによるものか判断が難しい.このため,50 MeV/c 前後で他の磁場設定の結果も確認する.磁場設定は 50 MeV/c から 53 MeV/c まで 1 MeV/c 刻みで比較する.このとき,各磁場設定は ID2(中心運動量:50 MeV/c)を基準に電流値を運動量でスケーリングして決定する.



図 5.3: 各輸送設定で再構成された運動量の分布 (Prompt timing から 200 nsec 以降のもの)

結果を図 5.3 に示す.運動量でスケールされた各輸送設定による結果を比較すると,分 布の形状自体に大きな差があるようには見えない.再構成数に関しては,高運動量側の輸 送になるにつれ数が少なくなる.重要な事実として,輸送前は同一の運動量分布であるが, H-Line 輸送によって運動量選択されるため,部分的にも同様な運動分布は得られず,この 状態でエッジの確認は困難である.そこで,H-line 輸送の運動量アクセプタンスの影響を評 価し,補正することで同様な運動量分布を再現する.

5.3 H-line 輸送運動量アクセプタンス評価

H-Line 輸送の運動量アクセプタンスを評価する方法として,運動量分布をフラットに生成した陽電子 (図 5.4) を輸送し,再構成された運動量分布を分子としてフラット分布を分母 に置く. H-Line で先ほどと同様な磁場設定 50,51,52,53 MeV/c で輸送した後、H-line の アクセプタンスを求め,シミュレーションのデータに補正を行うことで輸送前の同様な運動 量分布が得られるか確認する.



図 5.4: 45-60 MeV で運動量フラットに生成した陽電子

図 5.5 に、各運動量 50, 51, 52, 53 MeV/c に対する Acceptance をまとめる. 各輸送設 定での結果を比較すると,運動量分布の形状は概ね同様である. 低運動量に対して収量が多 く,中心運動量は輸送運動量と連動してスケールしている.



図 5.5: 各輸送設定での運動量アクセプタンス

この運動量アクセプタンスを用いて補正分布を作成する.補正の方法は元となる生の標 的由来の Michel positron の再構成運動量分布に対してアクセプタンス分布で割る.つまり, 補正分布 [corr] = 輸送の分布 [raw] / Acceptance.

5.4 H-line 輸送運動量アクセプタンス補正と実データ比較

運動量アクセプタンスを補正した運動量分布を図 5.6 に示す.補正前と比較すると高運動 量側の形状が同様な運動量分布を作っている.



図 5.6: 各輸送設定での運動量分布 [アクセプタンス補正分布] (Prompt timing から 200 nsec 以降のもの)

アクセプタンス補正により輸送設定間で同様な運動量分布を得られたので,Michel 崩壊 陽電子の分布との差異を確認する.補正した運動量分布と輸送前のMichel 崩壊陽電子の運 動量分布を比較する (図 5.7).以上から,標的由来のMichel positron を用いて運動量校正 を行なうにはアクセプタンスの影響を補正する処理が必要である.実データにおいてシミュ レーションと同様にアクセプタンス補正を行なうことで異なる輸送設定によるデータ取得 においても同様な運動量分布を得られるかを確認する必要がある.以下,シミュレーション と実データの比較を行なう.再構成された運動量分布を比較する前に,各WCのヒット数, 再構成数とPACMAN scanの比較を行なう.

5.4.1 各WCのヒット数の比較

2023年6月に J-PARC で ID30 のスケーリングで設定した輸送運動量 52 MeV から 57 MeV で遅延粒子を測定した.ここで得られたデータから,各WCのヒット数のシミュレー ションと実データの比較を行なった.磁気スペクトロメータの上流側から4台の MWPC それぞれ wc0, wc1, wc2, wc3と呼ぶ.ここでは2nd prompt timing から20.5 µs 後の各 WC へのヒット数を比較する.まず,標的由来の Michel positron の輸送シミュレーション



図 5.7: アクセプタンス補正分布と輸送前分布の比較



図 5.8: 各 WC の検出総数 (simulation) 2nd prompt timing から 20.5 µs 後

の結果を図 5.8 に示す.各WCのヒット数の実データは図 5.9 に示す.図 5.8 と比較すると, 輸送設定が高運動量側になるにつれヒット数はいずれの場合も減少する.各WCのヒット 数を比較すると,シミュレーションでは先頭の MWPC が最もヒット数が多いのに対し,実 データは 2 台目のヒット数が最も多い.



図 5.9: 各 WC の検出総数 (実データ) 2nd prompt timing から 20.5 µs 後

5.4.2 運動量構成数比較

次に 52~57 MeV/c 間の各輸送運動量設定で H-line 輸送および tracking simulation を行 い、再構成数を比較した (図 5.10). 57 MeV/c 輸送運動量の値を 1 として規格化する. シ ミュレーションの結果では低運動量側の設定になるにつれ再構成数は増加している. 実デー タにおいて,シミュレーションと異なり,55 MeV を境に減少に転じている. ここでヒット 数の推移から低運動量側の再構成数が増加し続けることが期待されるため,この点は要検討 である.

5.4.3 PACMAN Scan 結果比較

H-Line で輸送される粒子の理解のため,磁気スペクトロメータの輸送設定のみを変更し て再構成数の変化を確認する.H-line の輸送運動量を正電荷 52,55 MeV/c(p52,p55) の2パターンで固定し、磁気スペクトロメータの測定運動量設定のみ 35 60 MeV/c付近で 変化させる.これを PACMAN scan と呼ぶ.図5.11 に H-line 輸送運動量 52 MeV,図5.12 に H-line 輸送運動量 55 MeV の場合の PACMAN scan の結果を示す.それぞれ p52 では 52 MeV の値,p55 では 55 MeV の値で規格化をしている.測定運動量を変化させると,p52, p55 どちらの場合においてもシミュレーションと実データ共に H-line 輸送設定付近で再構 成数が上がり,輸送設定と測定設定のギャップが大きいほど再構成数は減少する.輸送設



図 5.10: 運動量再構成数の比較(simulation vs real data). ID30の 57MeV スケールでの 値を1として規格化

定と測定設定を共に変化させていたときには 55 MeV を境に低運動量域が減少していたが, PACMAN scan に置いては増加している. この点は要検討である.

5.5 バックグラウンドについて

標的由来の Michel 崩壊陽電子の測定において, バックグラウンドとなり得る粒子はビー ムライン中で発生する遅延陽電子である.即発粒子としてグラファイト標的で発生したパイ 中間子やミューオンは陽子の入射タイミングから 200 ns までにかけて H1 エリアまで輸送 されるため,直接のバックグラウンドにはならないが,ビームライン輸送中に寿命で崩壊 するものがある.H-Line は輸送設定運動量から外れた粒子をそらして目的運動量を選び出 すが,このときビーム軌道から外れながらも H1 エリアまで運ばれる陽電子を生むことがあ る.そこで,標的から H-Line に入射する正パイ中間子と正ミューオンを輸送し遅延タイミ ングにどの程度影響するかを調べる.輸送設定運動量を 52 MeV に設定して輸送し,陽子 の入射から 600 ns 後,陽子バルスビーム 1 回あたり(以下/ trigger と表記する)の結果を 図 5.13 に示す.バックグラウンドの陽電子数は目的粒子である標的由来の Michel positron 数の 0.06%程度で十分無視することができる.



図 5.11: H-Line の輸送設定 52MeV/cの PACMAN scan での再構成数 (simulation vs real data). Pacman momentum 52 MeV/cの値を1として規格化



図 5.12: H-Line の輸送設定 55MeV/cの PACMAN scan での再構成数 (simulation vs real data). Pacman momentum 52 MeV/cの値を1として規格化



図 5.13: 標的由来の Michel positron とビームライン中で発生した崩壊陽電子の運動量分布 比較 [H-Line 出口地点での分布 / trigger]

6 校正用試料の利用について

静止標的として HB2 の前方に校正用試料を配置し,崩壊粒子を磁気スペクトロメータで 再構成するシミュレーションを行なう.図 6.1 に校正用試料を用いたスペクトロメータの運 動量校正の概念図を示す.グラファイト標的から H-line に入射した低運動量の π^+ , μ^+ を (1)HS1-HS3 の区間で引き出す.(2)HB2 直前に設置した構成標的に π^+ , μ^+ を静止させる. (3) π^+ , μ^+ の崩壊で生成される高運動量 e^+ を取り出して,スペクトロメータで測定する. グラファイト標的から直接飛来する高運動量成分は (1) 上流と (3) 下流の輸送設定差により 取り除かれるため,スペクトロメータには到達しない.



spectrometer

図 6.1: 校正標的を用いたスペクトロメータ校正の概念図.(1)HS1–HS3 の輸送運動量設定は (2)の校正用試料位置以降の(3)HB2-spectrometerの中心運動量よりも小さく設定する.

6.1 π_{e2} 崩壊陽電子のシミュレーション

6.1.1 *π_{e2}* 崩壊陽電子のシグナル

 π_{e2} 崩壊を利用するためのセットアップは図 6.1 の (1) 部の運動量設定を 40 MeV, (2) 部 の運動量設定を 69.8 MeV と設定する. 校正用試料として厚み 1mm のアルミニウム板を使 用する.まず,グラファイト標的で生まれた π^+ を校正標的まで輸送する.校正標的直前の 運動量分布結果は図 6.2 に示す.輸送される運動量の範囲は 42(+3-7) MeV/c である.陽子 パルスビーム入射 1 回あたりの輸送数は 2189 event で,校正標的に静止したうちの約 99.98 % が $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_{\mu}$ 崩壊をする.



図 6.2: 陽子パルスビーム1回あたりに校正標的に到達する π⁺の運動量分布と粒子数

 $\pi^+ \to \mu^+ \nu_\mu$ 崩壊で放出される正ミューオンはエネルギーが低いため殆どその場で Michel 崩壊をして陽電子を放出する (図 6.3 の 52.8 MeV/c). 目的粒子である 2 体崩壊 $\pi^+ \to e^+ \nu_e$ の分岐比は 1.23 × 10⁻⁴ であり,崩壊陽電子の運動量は 69.8 MeV/c である. 2 体崩壊であ るため陽電子の運動量は単一で,グラファイト標的由来の Michel positron に比べ運動量校 正に適している.

69.8 MeV/*c* 付近の陽電子のみ取りだし H-line 出口まで輸送する.輸送粒子の運動量 分布,陽子パルスビーム1回あたりの数を図 6.4 に示す.陽子パルスビーム1回あたりの π_{e2} 崩壊陽電子数は 8.1 × 10⁻⁵ event である.



図 6.3: 校正標的から下流側に出てくる π_{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c) と Michel 崩壊陽電子 (52.8 MeV/c 以下) の運動量分布 (校正標的に当てる π^+ 数を 1e8 event に水増し)



図 6.4: 陽子パルスビーム 1 回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する π_{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c) の運動量分布と粒子数

6.1.2 *π*_{e2} 崩壊陽電子の測定でのバックグラウンド

校正標的であるアルミニウム板からは π_{e2} 崩壊陽電子の他に Michel 崩壊陽電子や π^+ が直接 物質からたたき出す陽電子が出てくる.これらバックグラウンドとなる陽電子の H-line 出口 までの輸送結果を図 6.5 に示す.バックグラウンドは陽子パルスビーム1回あたり 3.0×10⁻² event H-Line 出口までの輸送される.輸送設定は 69.8 MeV/*c* であるが, Michel 崩壊陽電子 の運動量域である 52.8MeV/*c* 以下の陽電子も輸送される.また、シグナル付近の運動量を もつ陽電子も来ているがこれは π^+ が直接物質からはじき出す陽電子であり、測定タイミン グを後ろにずらすと消える (図 6.6). Michel 崩壊陽電子は測定タイミングを後ろにずらし ても π^+ の方が短寿命 (寿命: π^+ 26 ns, μ^+ 2 µm) であるため、減らすことは難しい.これ らのバックグラウンドと目的粒子を見分けるには寿命スペクトルと運動量の違いを利用する 必要がある.



図 6.5: 陽子パルスビーム 1 回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する π_{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c, 赤) とバックグラウンド陽電子 (主に Michel 崩壊陽電子 (52.8 MeV/c 以下), 黒)の運動量分布と粒子数

6.2 Michel 崩壊陽電子のシミュレーション

6.2.1 Michel 崩壊陽電子のシグナル

校正標的まで輸送される正ミューオンは図 6.7 に示す. 輸送される運動量の範囲は 10 ± 2 MeV/c であり,校正標的であるカプトン 50 µm でほとんどが静止する. trigger あたりの 輸送数は 506 event である. このうち約 0.7% が校正標的に静止し Michel 陽電子を作る (図



図 6.6: 陽子パルスビーム 1 回あたり,入射から 250 ns 後の H-line 出口 (H1 エリア) に到達 する π_{e2} 崩壊陽電子 (69.8 MeV/c,赤) とバックグラウンド陽電子 (主に Michel 崩壊陽電子 (52.8 MeV/c以下),黒)の運動量分布.陽子パルスビームの入射からおよそ 200 ns 後に校 正標的に π^+ が入射されるため,さらに遅いタイミングを見れば π^+ が物質からはじき出す 陽電子は減少する.

6.8). このとき Michel 崩壊陽電子の運動量分布は少し歪むがエッジ部分は十分に保持される ため、グラファイト標的由来の Michel positron に比べ運動量校正に適している.



図 6.7: 陽子パルスビーム1回あたりに校正標的に到達する µ+の運動量分布と粒子数

続いて、下流部の輸送運動量を 52.8 MeV/c に設定し、輸送シミュレーションを行なう. H-line 出口まで輸送した結果を図 6.9 に示す. 校正標的で確認した 52.8 MeV/c のエッジが 確認できる. 輸送陽電子総数は陽子パルスビーム 1 回あたり 4.1 × 10⁻⁴ event である.

6.2.2 Michel 崩壊陽電子のバックグラウンド

校正標的の Michel 崩壊陽電子の測定において, バックグラウンドとなり得る粒子はビー ムライン中で発生する遅延陽電子である. 即発粒子としてグラファイト標的で発生したパイ 中間子やミューオンは陽子の入射タイミングから 200 ns までにかけて H-Line に入射する. 校正標的前後の輸送設定差から直接のバックグラウンドは低減されるが, ビームライン輸送 中に寿命で崩壊する. このときビーム軌道から外れながらも H1 エリアまで運ばれる陽電子 を生むことがある. 標的から H-Line に入射する正パイ中間子と正ミューオンを輸送し遅延 タイミングにどの程度影響するかを調べる. 結果を図 6.10 に示す. バックグラウンドの陽 電子数は 3.3 event / trigger であった.



図 6.8: 校正標的から下流側に出てくる Michel 崩壊陽電子の運動量分布(校正標的に当てる μ^+ 数を 1e8 event に水増し)



図 6.9: 陽子パルスビーム 1 回あたりに H-line 出口 (H1 エリア) に到達する Michel 崩壊陽 電子と粒子数



図 6.10: H-line 出口 (H1 エリア) に到達する Michel 崩壊陽電子(赤) とビームライン中で 発生した陽電子(BG,黒)の運動量分布(陽子パルスビーム1回あたり,入射から 600 ns 後)

7 結論

DeeMe 実験はミューオン・電子転換過程 ($\mu^- + (A, Z) \rightarrow e^- + (A, Z)$)の証拠である 105 MeV/c 遅延電子の測定を目指している. DeeMe では磁気スペクトロメータの運動量校正を 行なう.そのために,グラファイト標的由来の Michel positron や H ライン HB2 直上流部 に校正標的を設置し, π⁺ や μ⁺ 崩壊起源で運動量のよくわかっている陽電子を用いて校正 を行う. グラファイト標的由来の Michel positron 運動量分布は標的からの脱出により変形 するためそのまま校正に利用することは難しいが,G4-beamlineを用いてH-lineのアクセ プタンス評価を行い、測定結果に補正を加えることで最大運動量付近の運動量分布を確認 することが出来た. また, 遅延タイミングのバックグラウンドは 0.06% 程度であり十分に 低いことが分かった.今後は実データにも補正を加え最大運動量付近の運動量分布を確認 する. 校正標的を用いる方法としてビームライン途中にアルミニウム板(厚み1mm, 縦横 300×300mm²) やカプトンストリップ(厚み2µm, 縦 300 mm, 横2mm)を置き,静止 標的として利用する. グラファイト標的から 40 MeV/c の低運動量の正パイ中間子をアルミ ニウム板まで輸送し、静止、崩壊させる.その後、下流部で 69.8 MeV/c の輸送設定で輸送 するシミュレーションを行なった. その結果, H-Line 出口での陽子バルスビーム1回あたり の π_{e2} 崩壊陽電子数は 8.1×10^{-5} event であった. バックグラウンドの陽電子数は 3.0×10^{-2} event と分かった. 今後は磁気スペクトロメータでシグナルの運動量再構成が行えるかを確 認する.また,グラファイト標的から10 MeV/cの低運動量の正ミューオンをカプトンスト リップまで輸送し、静止、崩壊させる.その後、下流部で 52.8 MeV/c の輸送設定で輸送す るシミュレーションを行なった. その結果, H-Line 出口での陽子バルスビーム1回あたり の Michel 崩壊陽電子数は 4.1×10^{-4} event であった. 校正標的を用いる際のバックグラウ ンドとして標的由来の正パイ中間子と正ミューオンがビームライン中で遅延陽電子を生む可 能性がある.上流部からの陽電子は陽子パルスビーム 1 回あたり 3.3 event であった.今後 は、ビームラインに設置された粒子弁別装置を用いたバックグラウンドの低減を検討する必 要がある.

謝辞

本修士論文を執筆するにあたり、多くの方々にご指導ご鞭撻を賜りました。ここに深く感 謝の意を表したいと思います.大阪公立大学清矢 良浩教授には,物理学における基礎知識 や実験を遂行する研究者としての思考アプローチに加え、人生において重要な視点や考え 方など、これからの私の人生において大きな影響を与えるであろうことまで教えていただ きました. 微分型の生き方を胸に刻み、どのような状況下でも楽しもうと思います. また、 師と仰ぐ存在に出会えたことを心より喜ばしく思います.山本 和弘准教授には,研究室の パソコン関連の環境を構築していただきました.これまでの研究活動において、何不自由 なくデータ解析やコーディングを行えたのは山本教授の助力があってこそでした.豊田 博俊氏には,差し入れや研究活動の中でご意見をいただきました.手島 菜月氏には実験 だけで無く出張期間の移動や生活を支えていただきました.DeeMe の実験期間中にトラブ ルがあった際、的確な助言をいただき大変お世話になりました.また、MLF での差し入れ には元気をいただき、夜間のシフト中特にありがたかったです. 大阪大学の青木 正治教授 は、DeeMeのDAQのトラブル解決や実験機器等の扱い方について助言いただきました。お |手伝いいただきありがとうございました.同大学の東野 祐太氏には,東海村での実験にお いて DeeMe 遂行に多大なる貢献をしていただいたことに感謝の念を抱いております. 治具 設計やシミュレーション環境の構築など多くの場面でご指導いただいたことに感謝しており ます. KEK の山崎高幸氏には、MLF での実験において大変お世話になりました. H-Line のパフォーマンス改善に尽力していただき, DeeMe 実験を遂行する上で不可欠な存在でし た.本学高エネルギー物理学研究室の後輩であり、DeeMe 実験の一員でもある田中 甚吉 氏,梅井 一樹氏とは東海村で長く時間をともに過ごしました. 2023 年 1 月のビームタイ ムから始まり, 2024 年 3 月までの DeeMe ビームタイムの期間, 一筋縄ではいかない実験 の試行錯誤をする中で、非常に頼もしく感じておりました.他愛の無い日常の会話からも 非常に元気を頂きました.お二人が DeeMe の後輩で本当に良かったと感じています.同じ く, DeeMe の先輩の長谷 和哉氏には、まだ右も左も分からずに参加した 2022 年 1 月の H-Line commissioning から解析コードのプログラミングやガスシステムの運用方法など実 験に関する様々なことを教わりました.先輩として物理学の知識に限らず,実験遂行に真摯 に取り組む姿から一人の人間として非常に多くのことを学ばせていただきました.本学高 エネルギー物理学研究室の先輩の本條 貴司氏,後輩の山本氏は,所属する実験グループは 違えど研究室で顔を合わせた際,休憩がてらの他愛のない会話をすることが研究室に行く ことのひとつの楽しみでした.同期の金子 聡氏,川村悠馬氏とは苦楽をともにし,学業だ けでなく日常生活を彩るかけがえのない存在でした. メンタルコントロールのために行なっ た数々の奇行は忘れていただいてかまいません。就職活動や研究活動などの取り組みを共有 することで悔いのない充実した2年間を過ごすことができました.最後にこれまでの私の 人生を応援し、支えてくださった家族に心から感謝申し上げます.

参考文献

- 青木正治,「J-PARC RCS からのパルス陽子ビームを活用したミューオン・電子転換過 程探索実験 (DeeMe)」, 高エネルギーニュース Volume31 Number3, pp.228-237 (2012).
- [2] Gianluca Cavot, "Searching for the $\mu + \rightarrow e + \gamma$ decay with MEG and MEG-II," arXiv:1407.8327 (2014).
- [3] U.Bellgardt et al. (SINDRUM collaboration), "Search for the decay $\mu + \rightarrow e + e + e ,$ " Nucl.Phys. B299, 1 (1988).
- [4] W. Betrl et al. (SINDRUM collaboration), "A Search for muon to electron conversion in muonic gold," Euro. Phys, Vol. 31No. C47, pp. 337-346 (2006).
- [5] C. Dohmen et al. (SINDRUM collaboration), "Test of lepton-flavour conservation in μ
 e conversion on titanium," Phys. Lett. B317, 631 (1933).
- [6] K. Hayasaka, "Tau lepton physics at Belle," Nucl. Phys. B299, 1 (1988).
- [7] P. Abreu et al. (DELPHI Collaboration) Z. Phys. C 73, 243 (1997).
- [8] D. Ambrose et al. (BNL E871 Collaboration), "New Limit on Muon and Electron Lepton Number Violation from K0L \rightarrow µpme mp Decay," Phys. Rev. Lett. 81, 5734 (1988).
- [9] CLARK, Allan Geoffrey, et al. (CDF Collaboration), "Search for the Decays B0S $\rightarrow e+\mu$ and B0S $\rightarrow e+e$ in CDF RunII," Phys. Rev. Lett. 102.201801 (2010).
- [10] A. Czarnecki, X.G. Tormo, W.J. Marciano, "Muon decay in orbit spectra for µ e conversion experiments," Hyperfine Interact.210, 19-23 (2012).
- [11] 清水宏祐、「ミュー粒子・電子転換過程探索実験 DeeMe におけるアフタープロトン背景 事象および単一事象感度の評価」、大阪市立大学理学研究科高エネルギー物理学研究室 修士論文 (2015).
- [12] 「J-PARC 大強度陽子加速器施設」 https://j-parc/ja/jparc.html.
- [13] 高橋拓也,「µ-e 転換過程探索実験 DeeMe に用いられる高レート耐性 MWPC の充填ガ ス最適化および単一事象感度の評価」,大阪市立大学理学研究科高エネルギー物理学研 究室 修士論文 (2019).